

光応用・視覚研究会

〔委員長〕 亀井宏行（東京工業大学）
〔幹事〕 木下岳司（慶應義塾大学）， 君島 進（コバレントマテリアル）

日 時 平成21年3月19日（木） 13:30～17:20

場 所 電気学会第1～3会議室（東京都千代田区五番町6-2，HOMAT HORIZONビル8階，JR中央線（各駅停車）市ヶ谷駅下車，営団地下鉄有楽町線・南北線，都営地下鉄新宿線市ヶ谷駅下車，3番出口より徒歩2分，TEL：03-3221-7313，場所の詳細は以下のURLをご参照ください。

<http://www2.iee.or.jp/ver2/honbu/31-doc-honb/map.pdf>

協 賛 リソグラフィ極限技術調査専門委員会（委員長 堀内敏行，幹事 高橋信一，東 司）

議 題 テーマ「リソグラフィ極限技術」

LAV-09-25 液浸露光装置の現状と将来について

中村信一（ニコン）

LAV-09-26 hp 32nm以降のArF液浸DP用Freezing技術

稗田克彦，星子賢二，塩谷健夫，庵野裕輔，柿澤友洋，堀 雅文，征矢野晃雅
藤原考一，中村 敦，杉浦 誠，山口佳一，下川 努（JSR）

LAV-09-27 不均一なパターン密度においても均一で薄い残膜を形成するナノインプリント手法
廣島 洋（産業技術総合研究所）

15:00-15:20 《休憩》

LAV-09-28 EUV露光技術の開発現状

笠間邦彦（EUVA）
堀田和明（EUVA/ウシオ電機）

LAV-09-29 EUVLマスク評価の現状と今後の課題

木下博雄，渡邊健夫，原田哲男（兵庫県立大学）

LAV-09-30 EUVLにおけるリソグラフィシミュレーション

関口 淳（リソテックジャパン）

◎ 講演時間 1件当たり30分（質疑応答7分を含む）